



ArF 液浸スキャナー

NSR-S635E

Proven Solutions Through Evolution



重ね合わせ精度・スループットを向上させた 業界最高水準の 5 nm プロセス量産用 ArF 液浸スキャナー

ArF 液浸スキャナー NSR-S635E

NSR-S635Eは高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」を搭載することで重ね合わせ精度とスループットを同時に向上させた、5 nm プロセス量産用に開発された **Streamalign Platform** 採用の ArF 液浸スキャナーです。

これにより、NSR-S635Eは装置間重ね合わせ精度 (MMO: Mix and Match Overlay) 2.1 nm 以下、スループット毎時275枚以上 (96 shots) という極めて高い精度と生産性を実現しています。

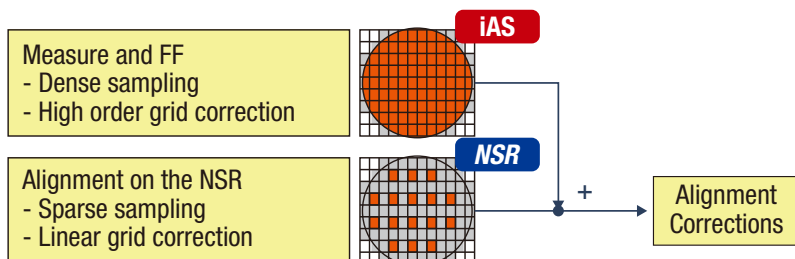
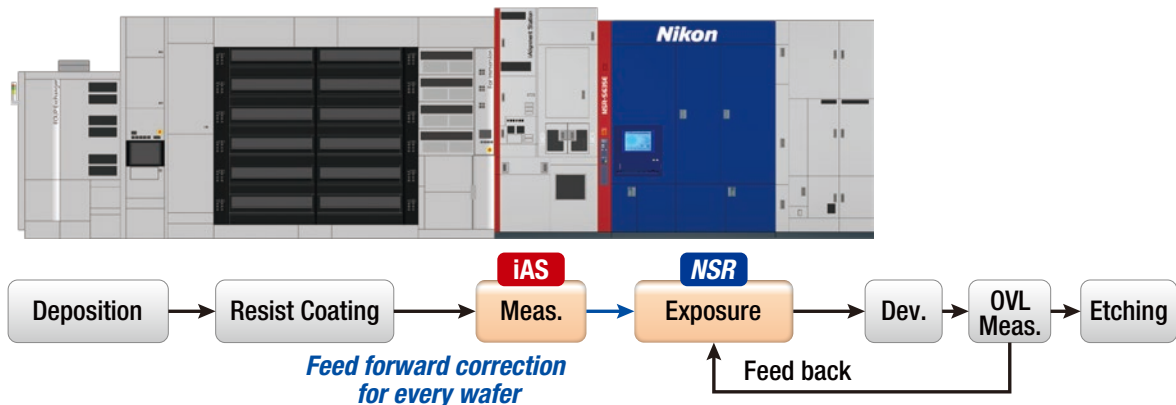
Performance

解像度	≤ 38 nm
NA	1.35
露光光源	ArF excimer laser (193 nm wavelength)
縮小倍率	1:4
最大露光範囲	26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度	SMO ^{*1} : ≤ 1.5 nm, MMO ^{*2} : ≤ 2.1 nm
スループット	≥ 275 wafers/hour (96 shots)

*1 Single Machine Overlay: 同一号機間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S635E#1 to S635E#1)

*2 Mix and Match Overlay: 同一機種間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S635E#1 to S635E#2)

高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」の特長



アライメントステーションとは、露光装置のスループットを落とすことなく高速・高精度にウェハを計測し、グリッドエラーの補正を可能にするシステムです。これをインラインで露光装置内に組み込んだものが iAS になります。iAS により、スループットを低下させることなく、全ショットでの多点アライメントが可能になり、飛躍的な精度向上を実現しました。

クラス1レーザ製品

⚠ 安全に関するご注意

■ ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご 注 意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

●このカタログは2018年11月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2018 NIKON CORPORATION

<http://www.nikon.co.jp/pec>

株式会社 **ニコン**

半導体装置事業部 事業企画部 108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟 電話 (03) 6433-3639

株式会社 **ニコンテック** 140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21 東神ビル 電話 (03) 5762-8911